

# СОДЕРЖАНИЕ

## ФИЗИЧЕСКАЯ ОПТИКА

- 3 Performance Evaluation of Optical Add Drop Multiplexers with Mach-Zehnder interferometer Techniques for Dense Wavelength Division Multiplexed System  
Оценка характеристик оптических мультиплексоров на базе интерферометра Маха-Цендера для волоконных систем с плотным спектральным уплотнением  
Sanjeev Dewra, Dr. R.S. Kale

## ЛАЗЕРНАЯ ФИЗИКА И ТЕХНИКА

- 11 Исследование кинетики электропроводности кристаллов КТР, применяемых в модуляторах твердотельных лазеров  
Русов В.А., Захаров Н.А., Каплун А.Б., Мешалкин А.Б., Горчаков А.В.

## РАСЧЕТ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

- 17 Выбор оптимальной конструкции оптического затвора на  $\pi$ -ячейке  
Симоенко Г.В., Студенцов С.А., Ежов В.А.
- 23 Измерение инструментальной поляризации, вносимой катадиоптрическим объективом  
Савикин А.П., Шутов А.М.
- 27 Концепция построения оптической схемы панорамного стоке-поляриметра для малых телескопов  
Сниязский И.И., Иванов Ю.С., Видьмаченко А.П.
- 33 The choice method of light source radius in X ray phase contrast imagins system  
Выбор радиуса источника в фазовоконтрастном методе формирования рентгеновских изображений  
Jie Wu

## ОПТИЧЕСКОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ

- 39 Автоклиматизируемый пульс-индикатор: разработка и применение в динамической гониметрии  
Ларичев Р.А., Физатов Ю.В.

- 45 Оптический цифровой автоматизированный измеритель отклонений от прямолинейности  
Корелев А.Н., Луккин А.Я., Полицук Г.С., Трегуб В.П.
- 51 Телевизионная аппаратура для работы в условиях высоких радиационных полей  
Сенаторов В.Н., Катушин Е.И.
- 54 Математическое моделирование регистрируемых сигналов в медицинской лазерной неинвазивной флюоресцентной диагностике  
Рогаткин Д.А., Смирнова О.Д.

## ОПТИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ

- 61 Сравнительный анализ критериев устойчивости интерференционных покрытий  
Котликов Е.Н., Новикова Ю.А.
- 68 Изменение шероховатости поверхности  $CVD-ZnSe$  при механической обработке в зависимости от размера зерна суспензии  
Вилкова Е.Ю., Тимофеев О.В., Носов С.А., Дубовой А.И.

## ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

- 73 Новый метод формирования литографической маски или рельефа непосредственно в процессе электронно-лучевого экспонирования резиста  
Брук М.А., Жихарев Е.Н., Кальнов В.А., Спирин А.В., Стрельцов Д.Р.